

国際粉体工業展東京 2016

出展のご案内

今回の「国際粉体工業展東京 2016」では、高機能材料の開発・製造を対象に、H₂やO₂、真空など雰囲気下で金属の変性処理を可能とした熱処理装置や、繊維状原料の粉碎等、各種粉体処理機器を出展します。是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

記

会 期： 2016年11月30日(水)～12/2日(金) 10:00～18:00 *12/2は17:00迄。

会 場： 東京ビッグサイト 弊社ブース 東1ホール D-05

<p>多目的水素ロータリーキルン</p> <p>水素や純 O₂などのガス雰囲気や高真空中で金属変性処理を可能とした、多目的焼成機</p> <p>本装置は、水素や純 O₂、高真空など様々な雰囲気下で、加熱と冷却の熱制御を行い、金属の変性処理を可能とした多目的焼成装置です。レトルト回転により対象原料を流動させながらガス圧や流量と温度の制御を行い、効率的に反応を促進させる事が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none">・水素還元・水素吸蔵・水素脆性など、金属処理工程を本装置1台で対応。・加熱のみならず、強制冷却が可能。著しい設備削減とランニングコストダウンを実現。・新素材開発の試験装置や小規模生産機として、最適。	
<p>ファイバーミル</p> <p>繊維状原料の大量・連続処理剪断を可能とした、高速剪断粉碎機</p> <p>本装置は、高速回転する回転刃と固定刃で、繊維状の原料を連続的に剪断粉碎する粗粉碎機です。多段に配置された固定刃間を、複数の粉碎刃が回転通過する事で、連続的に大量の繊維原料を剪断粉碎する事が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none">・大形状の繊維原料を、直接剪断微細化。・粉碎工程の著しい設備削減とランニングコストダウンを実現。・用途に応じ、粉碎刃・セパレーターの形状や材質の選定可能。	
<p>真空ロータリーキルン</p> <p>真空雰囲気 で連続高温焼成が可能なロータリーキルン</p> <p>太陽電池や二次電池材料など、エネルギー分野においては新素材開発が重要なカギとなり、従来にはない条件下での粉体操作が不可欠となります。真空ロータリーキルンは、1,000℃の高温下 1Pa の真空度の保持が可能です。無酸素下での粉体の連続焼成に対応します。また、H₂ 雰囲気での還元や脆性処理、様々なガス雰囲気での連続焼成が可能です。</p>	
<p>真空アキシャルミキサー</p> <p>異形状材や少量分散に最適な強制混合機</p> <p>アキシャルとは「軸方向への運動」の意味です。混合槽底面に傾斜角を持たせ、円周及び上下方向に複雑な原料対流を発生させて、混合を促進させます。微量添加材の分散や異形材料(粉+繊維)等の強制混合に適します。真空下では、減圧乾燥や脱泡混合が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none">・短時間での分散混合。(金属コンタミネーション防止)・特殊形状の混合槽により、製品の完全排出や清掃性が容易。・セラミック溶射や樹脂コート等の処理が可能。	